SHARP	HALAMAN : 10	F 8
PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	NO. DOK. : E -	W - CMWC - 004
	NO. REVISI : 03	· -
	BERLAKU : 1 N	OVEMBER 2011
INSTRUKSI KERJA < WORK INSTRUCTION>	DISETUJUI	DIBUAT
	EMR	CMWC
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHA</td><td>N KIMIA < CHEMICAL</td><td>SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		

1.TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pengendalian tumpahan bahan kimia.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku di proses yang menggunakan dan menyimpan bahan kimia.

3.DEFINISI

- 3.1 MSDS singkatan dari Material Safety Data Sheet.
- 3.2 CMWC singkatan dari Chemical Management Working Committee
- 3.3 Tumpahan kecil adalah tumpahan yang kira kira ukurannya berdiameter kurang dari 30.5 cm (< 30.5).</p>
- 3.4 Tumpahan besar adalah tumpahan yang diameternya berukuran lebih dari 30.5 cm (≥ 30.5 cm).

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 E W CMWC 01 : Penyimpanan Bahan Kimia
- 4.2 E W CMWC 02 : Penanganan Bahan Kimia
- 4.3 E W CMWC 03 : Label Bahan Kimia
- 4.4 E W CMWC 05 :
 Pengendalian MSDS Bahan Kimia

1.PURPOSE

The purpose of this procedure is to describe a method for spill of chemical.

2.SCOPE

This procedure applicable only for process which use and keep chemical.

3. DEFINITION

- 3.1. MSDS stands for Material Safety Data Sheet
- 3.2. CMWC stands for Chemical Management Working Committee
- 3.3. Small spill is spill which are approximately less than 30.5 cm (< 30.5 cm).</p>
- 3.4. Large spill is spill which are over than 30.5 cm (>30.5 cm).

4. RELATED DOCUMENT

- 4.1 E W CMWC 01 : Chemical Storage
- 4.2 E W CMWC 02 : Chemical Handling
- 4.3 E W CMWC 03 : Chemical Labeling
- 4.4 E W CMWC 05 : Chemical MSDS Control

SHARP	HALAMAN : 2 DARI 8	
PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	NO. DOK : E – W – CMWC – 004	
	NO. REVISI : 03	
	BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011	
INSTRUKSI KERJA <work instruction=""></work>		
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA <CHEMICAL SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		

4.5 E - W - CMWC - 06 : Perawatan Ruang Bahan Kimia dan Fasilitas Penanganan Tumpahan. 4.5 E – W – CMWC – 06 : Maintenance of Chemical Room and Spill Control Facilities.

5.PENANGGUNG JAWAB

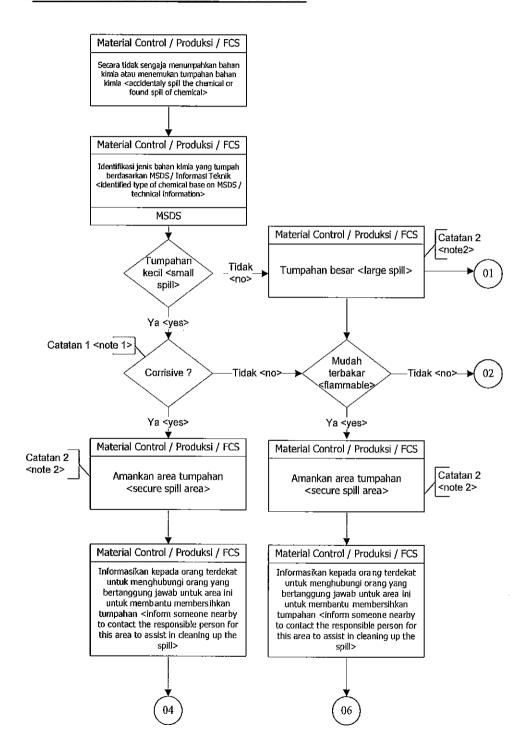
- 5.1 CMWC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tumpahan bahan kimia ditangani sesuai dengan perundang – undangan dan persyaratan sistem manajemen lingkungan perusahaan.
- 5.2 Kepala Seksi bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penanganan tumpahan bahan kimia sesuai dengan perundang – undangan dan persyaratan sistem manajemen lingkungan perusahaan.
- 5.3 Semua karyawan terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini.

5. RESPONSIBILITY

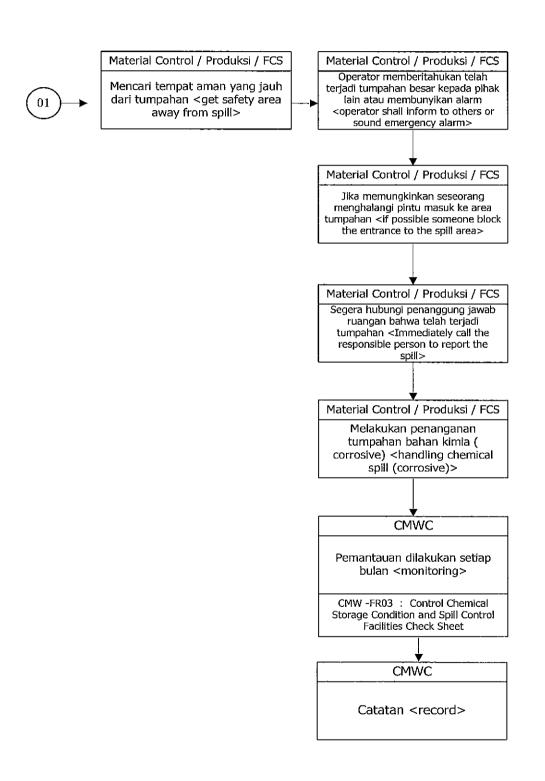
- 5.1 CMWC is responsible to ensure that spill of chemical is fully handle compliance with legislation and company EMS requirements.
- 5.2 Head of Section is responsible to ensure that implementation for handling spill of chemical is in compliance with legislation and company EMS requirements.
- 5.3 Relevant employee is responsible to apply this procedure

SHARP	HALAMAN : 3 DARI 8	
PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	NO. DOK : E – W – CMWC – 004	
	NO. REVISI : 03	
	BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011	
INSTRUKSI KERJA < WORK INSTRUCTION>		
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA <CHEMICAL SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		

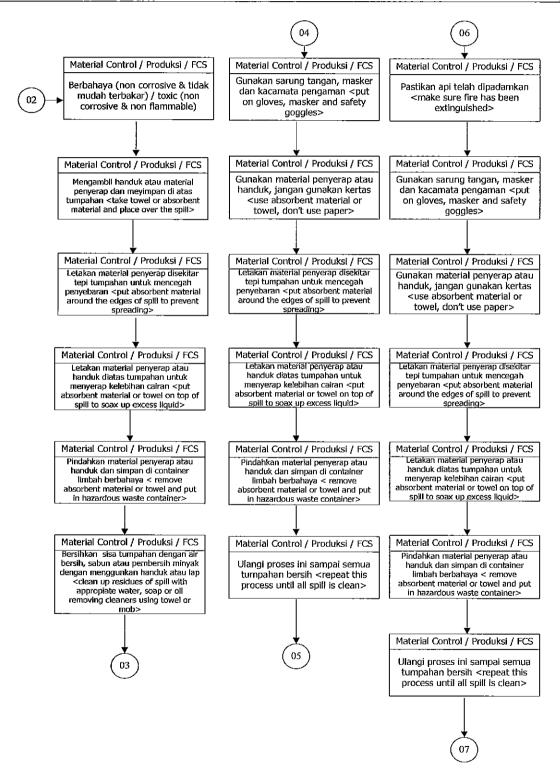
6.RINCIAN PROSEDUR<PROCEDUR IN DETAIL>



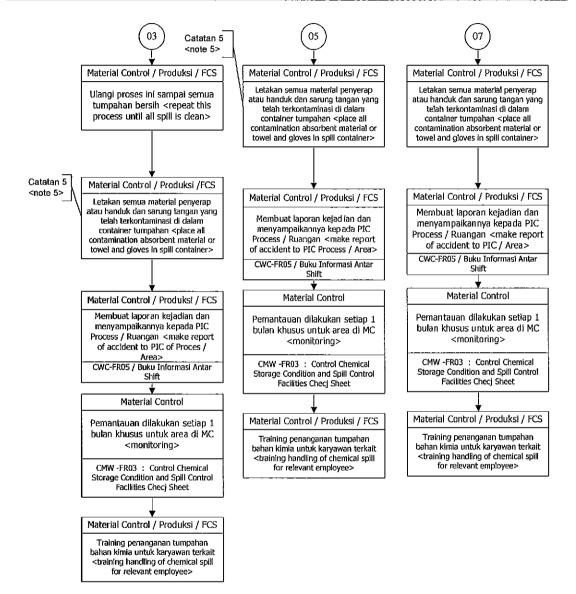
SHARP PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	HALAMAN : 4 DARI 8 NO. DOK : E - W - CMWC - 004 NO. REVISI : 03 BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011	
INSTRUKSI KERJA < WORK INSTRUCTION>		
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA <CHEMICAL SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		



PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA HALAMAN : 5 DARI 8 NO. DOK : E - W - CMWC - 004 NO. REVISI : 03 BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011 INSTRUKSI KERJA < WORK INSTRUCTION> JUDUL <TITLE> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA < CHEMICAL SPILL CONTROL>



SHARP PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	HALAMAN : 6 DARI 8	
	NO. DOK : E – W – CMWC – 004	
	NO. REVISI : 03	
	BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011	
INSTRUKSI KERJA <work instruction=""></work>		
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA <CHEMICAL SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		



SHARP	HALAMAN : 70	F 8
PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	NO. DOK. : E -	W - CMWC - 004
	NO. REVISI : 03	
	BERLAKU : 1 N	OVEMBER 2011
INSTRUKSI KERJA <work instruction=""></work>	DISETUJUI	DIBUAT
	EMR	CMWC
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHA</td><td>N KIMIA <CHEMICAL</td><td>SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>		

7.CATATAN

7.1 Catatan 1

Untuk material yang berisi 2 atau 3 jenis bahan kimia, ikuti prosedur untuk material utamanya.

7.2 Catatan 2

Jika tidak dapat membersihkan tumpahan maka amankan area tumpahan segera hubungi Head of Section.

7.3 Catatan 3

Sampaikan ke penanggung jawab ruangan :

- Tujuan memanggil " laporan tumpahan "
- 2. Nama pelapor
- 3. Laporan kerugian
- 5. Lokasi tumpahan
- 6. Nama material (jika tahu)

7.4 Catatan 4

Bersihkan tumpahan berdasarkan jenis tumpahan (corrosive, mudah terbakar, beracun)

7.5 Catatan 5

Beri label container limbah bahan kimia.

7.NOTE

7.1 Note 1

For material content 2 or 3 chemical type, follow procedure for main material.

7.2 Note 2

if you can not clean up the spill, secure spill area immediately and contact Head of Section

7.3 Note 3

Inform to responsible person:

- Purpose for calling " report chemical spill "
- 2. Name of reporter
- 3. Injury report
- 4. Spill area
- 5. Name of material (if known)

7.4 Note 4

Cleanup the spill according to kind of spill (corrosive, flammable,toxic)

7.5 Note 5

Give label the container chemical waste.

SHARP PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA	HALAMAN : 8 DARI 8 NO. DOK : E - W - CMWC - 004 NO. REVISI : 03
	BERLAKU : 1 NOVEMBER 2011
INSTRUKSI KERJA < WORK INSTRUCTION>	
JUDUL <title> : PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHA</td><td>N KIMIA < CHEMICAL SPILL CONTROL></td></tr></tbody></table></title>	

8. DOKUMEN PENDUKUNG<SUPPORTING DOCUMENT>

No.	Judul <title></th><th>Masa Simpan</th><th>Penanggung jawab</th></tr><tr><td></td><td></td><td><Storage Time></td><td><Responsibility></td></tr><tr><td>1</td><td>CWC - FR03 : Control Chemical Storage</td><td>3 tahun<year></td><td>CMWC</td></tr><tr><td></td><td>Condition and Spill Control Facilities Check</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sheet</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>CWC - FR05 : Chemical Report</td><td>3 tahun<year></td><td>CMWC</td></tr><tr><td>3</td><td>Buku Informasi Antar Shift</td><td>3 tahun<year></td><td>Production</td></tr></tbody></table></title>
-----	--

9. CATATAN PERUBAHAN <REVISION RECORD>

No. Rev.	Perubahan <revision></revision>	Tanggal <date></date>
01	Mengganti para 5.2 <change 5.2="" para=""> Head of Division<kepala divisichange="" kepala<br="">Seksi <head of="" section=""></head></kepala></change>	14 Mei 2007
	Mengganti para 5.3 <change 5.3="" para=""> Karyawan<operator or="" relevant=""> change Semua karyawan <all employee="" relevant=""></all></operator></change>	
	Revisi prosedur di flow chart <revision chart="" flow="" in="" procedure=""></revision>	
	Mengganti para 7.1 <change 7.1="" para=""> prosedur penyimpanan masing – masing <each type=""> changeikuti prosedur<follow procedure=""></follow></each></change>	
	Mengganti para 7.5 <change 7.5="" para=""> "Limbah tumpahan"<"Hazardous waste"> changelimbah bahan kimia<chemical waste=""></chemical></change>	
02	Menambahkan dokumen pendukung <additional 8.1="" para=""></additional>	5 Januari 2009
	No. 3 Buku Informasi Antar Shift	
	Menambahkan dokumen pendukung ini di flow chart <additional chart="" document="" flow="" in="" supporting=""></additional>	
03	Menghilangkan kata informasi di flow chart <delete chart="" flow="" in="" informasi=""></delete>	20 Oktober 2011
	Pemantauan dilakukan setiap 1 bulan khusus untuk area di MC <monitoring 1="" every="" for<br="" month="">area in MC</monitoring>	